This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Pullication number :

2001-209052

(43) Date of publication of application: 03.08.2001

(51) Int. CI.

GO2F G02F 1/139

(21) Application number: 2000-014545 (71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

24.01.2000

(72) Inventor :

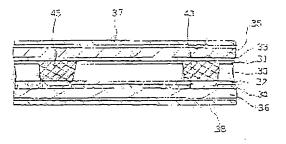
MOCHIZUKI HIDEAKI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a liquid crystal display device with high displaying precision irrespective of reduction of rubbing aligning treatment steps for the purpose of solving the problem resulting from the nonuniform rubbing aligning treatment.

SOLUTION. The method is provided with a step to form an alignment film 32 on the side of the first substrate 36 and subsequently to treat it with rubbing aligning, a step to form a spacer pattern 43 on the side of the second substrate 35, a step to form an alignment film 31 without the rubbing aligning treatment and a step to inject a liquid crystal 30 to which a chiral material is added to make the helical pitch p satisfy the relation $p=(360/\theta) \times d$ (provided that Bexpresses the twist angle of the liquid ·crystal molecules).



| 1 | |
|-------------|--------------------------|
| 20 高温 经市场通路 | 3.5 前2の手板 |
| est ansigns | 5 8 18 nub |
| 等名 新河區 | ଓ ମି. ନାଷ ଅପ୍ରେ ଶ |
| 318 BACE | 4つ はや サバをジ |
| の祖 アルキュア | |
| | |

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-209052 (P2001 - 209052A)

(43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

| (51) Int Cl.7 | | 識別記号 | FI | | | テーマコード(参考) |
|---------------|-------|------|------|--------|-----|------------|
| G02F | | 500 | G02F | 1/1339 | 500 | 2H088 |
| | 1/139 | | | 1/137 | 505 | 2H089 |

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 10 頁)

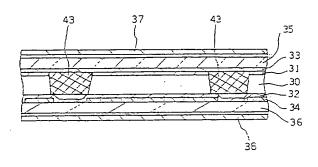
| (21)出願番号 | 特願2000-14545(P2000-14545) | (71) 出額人 000005821 松下電器産業株式会社 |
|----------|---------------------------|--|
| (22)出顧日 | 平成12年1月24日(2000.1.24) | 大阪府門其市大字門真1006番地 (72)発明者 窒月 秀晃 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 |
| | | (74) 代理人 100105809 弁理士 木森 有平 |
| | | F ターム(参考) 2H088 FA02 GA17 HA03 HA08 JA05 JA13 KA12 LA04 MA04 MA17 2H089 HA29 LA10 MA03X NA01 NA21 QA14 QA15 RA05 RA10 SA17 TA04 TA09 |

(54) [発明の名称] 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 ラビング配向処理の不均一による問題を解消 するためにラビング配向処理の工程を削減しながらも、 表示精度の高い液晶表示装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 第1の基板側36に配向膜32を形成し た後ラビング配向処理する工程と、第2の基板側35に スペーサバタン43を形成する工程と、ラビング配向処 理しない配向膜31を形成する工程と、螺旋ピッチャが $p = (360/6) \times d$ (但し、 θ は液晶分子のネジレ 角度を表す)の関係を満たすようにカイラル材を添加し た液晶30を注入する工程とを備える。



| 3 0 | 版品(混合被品租成物) | 3 5 第 2 の基板 |
|-----|-------------|--------------|
| 3 1 | 起向展 | 36 加1の基板 |
| 3 2 | 紀何度 | 3 7. 3 8 優光板 |
| 3 3 | 共通電極 | 43 スペーサバタン |
| 3 4 | 画素定框 | |
| | | |

【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する第1の基板と第2の基板との間に液晶が狭持されると共にスペーサパタンによって両基板間のセル厚を形成する液晶表示装置において、

第1の基板側に、ラビング配向処理した配向膜が形成され、

第2の基板側に、スペーサバタンがセル厚dで形成されるとともに、配向膜がラビンク配向処理しないで形成され、

液晶は、螺旋ピッチャが $p=(360/\theta)\times d(\theta)$ し、 θ は液晶分子のネジレ角度を表す)の関係を満たすようにカイラル材が添加されいることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 対向する第1の基板と第2の基板との間に液晶が狭持されると共にスペーサパタンによって両基板間のセル厚を形成する液晶表示装置の製造方法において、

第1の基板側に配向膜を形成した後ラビング配向処理する工程と、第2の基板側にスペーサパタンを形成する工程と、ラビング配向処理しない配向膜を形成する工程と、螺旋ピッチpがp=(360/8)×d(但し、母は液晶分子のネジレ角度を表す)の関係を満たすようにカイラル材を添加した液晶を注入する工程とを備えることを特徴とする液晶パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、所定の厚さを有するスペーサパタンによってセル厚を形成する液晶表示装置及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術)液晶の光学異方性を応用した液晶表示装置として、薄膜トランジスタ(以下、TFT)や二端子素子などのアクティブ素子により液晶パネルを駆動させるアクティブマトリックス駆動方式と、対向する基板の各々に有するストライプ状の透明電極が互いに直交するように配置され、透明電極の交差する領域の液晶分子をアクティブ素子を用いずに駆動させる単純マトリックス駆動方式とがある。前者のアクティブマトリックス駆動方式では、対向する基板間で液晶分子が90°ねじれたツイステッドネマチック(以下、TN)液晶パネルが多く用いられ、後者の単純マトリックス駆動方式では、対向する基板間で液晶分子が180°~270°ねじれたスーパーツイステッドネマチック(以下、STN)液晶パネルが多く用いられる。

【0003】各種液晶パネルでは、応答速度やコントラストや視野角が液晶層の厚み(以下、「セル厚」又は「ギャップ」という)に依存することが知られており、特に、高いコントラストを得るためには、セル厚を高度に制御しなければならない。例えば、アクティブマトリックス駆動方式の液晶パネルでは、第1の基板と第2の

基板との間に液晶が封入されるが、スペーサによってセル厚が決められる。液晶パネルの製造方法としては、対向する両基板に各々配向膜を塗布した後、配向膜を塗布した後、配向膜を塗布した後、両基板を貼り合かせることが一般的に行われる。液晶を両基板間に注入でする方法としては、両基板を貼り合わせた後液晶を注入する方法と、液晶を滴下してから両基板を貼り合わせる方法と、液晶を滴下してから両基板を貼り合わせる方法と、液晶を滴下してから両基板を貼り合わせる方法と、液晶を滴下してから両基板を貼り合わせる方法も使用される。なお、対向する基板としては、ガラス基板が一般的に使用されているが、情報機器の携帯用途への展開が進むにつれて、より軽量化を進めるため、有機高分子材料(プラスチック)を基材とするディスプレイも実用化が進んできた。ただ、基板のプラスチック化は、画質の均一性とは相反する要素が多い。

【0004】スペーサの材質としては、ロッド状のグラスファイバや球状のプラスチック粒などが使用され、基板の上方から前記スペーサ粒子を散布することによって、基板上の任意の位置にスペーサを分散させる方法が一般的である。しかし、このスペーサ散布方法では、以下の原因によりスペーサ粒子散布の不均一やギャップ不均一が発生していた。すなわち、①前電気によりスペーサ粒子が凝集すること、②散布時に使用するスペーサ分散液が基板上に落下するため、基板上のスペーサ粒子の分散が不均一になること、②スペーサ粒子の大きさにばらつきがあること、②基板表面はTFTや電気回線等がパターンニングされており、基板上に凹凸部があるため、同一の大きさのスペーサ粒子を使用しても散布位置によってギャップが異なること等である。

【0005】このような問題を解決するために、オフセ ット印刷法等を利用して基板間のギャップを形成する液 晶パネルが提案されている。これは、従来のスペーサ分 散方法を使用するものとは異なり、スペーサ粒子を使用 することなく、基板上の所定の位置に所定の厚さを有す るスペーサパタンを直接形成することにより両基板間の ギャップを形成している。アクティブマトリックス駆動 方式の液晶パネルでは、一対の透明電極付き基板のうち の一方の基板の透明電極表面に、スペーサパタンがセル 厚で形成されるとともにラビング配向処理が行われる配 向膜が形成される一方、スペーサバタンが形成されてい ない側の第2の基板の基板側にも、配向膜が塗布される とともにラビング配向処理される。また、両基板表面の 配向膜は両配向膜のラビンク方向が90度になるように ラビング配向処理するため、封入されている液晶は配向 膜の配向規制力により界面においてラビング方向に配向 し、90度のねじれを形成している。また、液晶は配向 膜の界面において一軸方向に配向することによりプレチ ルト角も一定に発生している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、スペー サバタンを形成する方法では、電極にスペーサバクンを 形成した後にラビング配向処理するため、スペーサパタンの段差の陰になる部分では十分なラビング配向処理ができない問題があり、そのため、均一で欠陥のない液晶分子の配向状態を得ることは困難であった。すなわち、液晶分子は、ラビング方向に沿った配向を示すが、配向がラビングされない部分では配向膜の液晶分子の配向規制力が発揮されず、配向不良が生じる。配向が不充の領域の異なった配向の領域が存在することとなり、それぞれの領域の境界では液晶分子の配向が不連続なディスクリネーションが発生し、光ぬけとなる。つまり、配向が充分な領域では、中間電圧下でである。の間に配向状態で暗くなるが、配向が不充分な領域では、部分的に光ぬけが生じたり、暗部と明部とが隣接して存在するような輝度ムラの状態が発生する。

【0007】このラビングむらの問題を解決するために、スペーサパタンの段差の側面壁に一定の傾きを設ける方法が提案されている(特開平6-273735号公報参照)。この傾きによってスペーサパタンの段差の陰になる部分にもラビング配向処理が行うことができるが、この方法では、スペーサパタンの側面壁に傾きを設けるための工程が必要であり、かつ、その角度は所定の角度以下であることを必要とするため、高い精度のの類を必要とする。また、スペーサパタンの画側壁に一定の傾きを設けることは、スペーサパタンの基板に接する面積が小さくなり、基板間のギャップの確保が十分でなくなるおそれが生じ得る。

【0008】なお、ラビングにより配向処理すると、摩擦による静電気が発生し、配向膜に絶縁破壊が起きたり、その部分の配向不良によって表示不良の原因となる場合がある。また、ラビング配向処理すると、液晶分の配向方向が一様なために、画面を見たときの表示が見やすい角度が特定の角度範囲に制限されるという、いわゆる視野角依存性を持つことが知られている。

【〇〇〇9】そこで、本発明の第1の目的は、スペーサパタンによって基板間のセル厚を形成する液晶表示装置において、ラビング配向処理の不均一による表示ムラを解消し、液晶表示の均一性を向上させる液晶表示装置を提供することを目的とする。また、本発明の第2の目的は、ラビング配向処理の不均一による問題を解消するためにラビング配向処理の工程を削減しながらも、表示精度の高い液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

(0010)

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の 液晶表示装置は、対向する第1の基板と第2の基板との 間に液晶が狭持されると共にスペーサパタンによって両 基板間のセル厚を形成する液晶表示装置において、第1 の基板側に、ラビング配向処理した配向膜が形成され、 第2の基板側に、スペーサパタンがセル厚せで形成され るとともに、配向膜がラビング配向処理しないで形成さ れ、液晶は、螺旋ビッチpがp=(360/e)×d (但し、θは液晶分子のネジレ角度を表す)の関係を満たすようにカイラル材が添加されいることを特徴とする。

[0011] 本発明によれば、液晶は螺旋ビッチャがトー(360 $/\theta$)×dの関係を満たすようにカイラル材が添加されることで、第2の基板の配向膜の配向規制力によらずとも液晶分子の適切なねじれが形成される。また、スペーサパタンが形成されていない第1の基板側にはラビング配向処理した配向膜が形成されており、その配向膜の界面において液晶分子を一軸方向に配向させることができる。一方、スペーサパターンが形成される第2の基板表面にはラビング配向処理しない配向膜が形成されるため、第2の基板側ではスペーサパターンの厚さの不均一によるラビングむらの問題が生じることがなり、

[0012] 他方、請求項2記載の液晶表示装置の製造方法は、対向する第1 の基板と第2 の基板との間に液晶が狭持されると共にスペーサパタンによって両基板間のセル厚を形成する液晶表示装置の製造方法において、第1 の基板側に配向膜を形成した後ラビング配向処理する工程と、第2 の基板側にスペーサパタンを形成する工程と、ラビング配向処理しない配向膜を形成する工程と、気にカイで配向処理しない配向膜を形成する工程と、螺旋ピッチャが $p=(360/\theta)\times d(\theta \cup \theta \cup \theta \cup \theta)$ 品分子のネジレ角度を表す)の関係を満たすようにカイラル材を添加した液晶を注入する工程とを備えることを特徴とする。

 $\{0013\}$ この方法によれば、スペーサパタンが形成される第2の基板側では、スペーサパタンに配向膜を形成するが、配向膜をラビング配向処理しないため、第2の基板側ではラビング配向処理が不要になる。したがって、ラビング配向処理の不均一の問題が発生することがって、ラビング配向処理した配向膜が形成されない第1の基板では、ラビング配向処理した配向膜が形成されるに、配向膜の界面において液晶分子を一軸方向に3をせることができる。また、螺旋ビッチャがカーに3をせることができる。また、螺旋ビッチャがカーに3をすりの関係を満たすようにカイラル材を添加した変晶をすりの関係を満たすようにカイラル材を添加した変晶を注入するために、第2の基板側の配向膜をラビング配向処理しなくとも液晶分子の適切なネジレが形成される。

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して詳細に述べる。

【0015】(第1の実施の形態の液晶表示装置の構成)本実施の形態の液晶表示装置は、TFT方式のアクティブマトリックス駆動方式の液晶表示装置に本発明を適用したもので、図1乃至図3に示すように、第1の基板36には、マトリックス状に配置されるTFT42、画素電極34、配向膜32が形成される一方、第2の基板35には、対向電極31上にスペーサバタン43が形

成されている。第1の基板36と第2の基板35とは、その間に液晶30を狭持し、その両外側に偏光板37,38を配している。

【0016】第1の基板36は、横253mm、縦190mmのサイズであり、図2の平面図に示すように、第1の基板36上には、TFT42と、TFT42のソース、ドレイン、ゲートの各電極配線(図示せず)や画素電極34が配されている。画素電極34は、インジウム・錫酸化物(以下、ITO)薄膜を用いた透明電極であり、画素電極34での電界のスイッチングを各画素毎に形成したTFT42で制御する。画素のピッチは、行方向300ミクロンで600本、列方向100ミクロンで2400本であり、画素間スペースは縦・横ともに15ミクロンである。

【0017】配向膜32は、ポリイミド材料で、日本合成ゴム株式会社製オプトマーAL1254を使用している。200°Cで1時間加熱乾燥した後の厚さは50nmであり、通常の回転ラビング方法により配向処理が施されている。配向膜32をラビング配向処理することによって、配向膜32の界面において液晶分子を一軸方向に配向させることにより配向膜32においてプレチルト角を一定方向に発現させることができる。

【0018】一方、第2の基板35は、横248mm× 縦187mmのサイズであり、第2の基板35の全面にはパターン化していないITO33が形成されている。ITO33上には、厚さ5.1μmの黒色感光性ポリイミド材料によるスペーサパタン43が形成され、画素電極34側の第1の基板36と第2基板35との間に挟持されることによって両基板35、36間のギャップ(セル厚d)を形成している。なお、第1の基板36と第2の基板35は、ガラスが使用されている。

[0019] スペーサバタン43は、図2に示すように 画素電極34に相当する部分以外の全部分において厚さ 5.1μmに形成されている。このように画素電極34に相当する部分のみを開口するように、画素電極34に相当する部分以外の部分にスペーサバタン43を研状に 形成するのは、スペーサバタン43によって照射される 光が返られることによる輝度むら等の発生を防ぐためで ある。ラビング配向処理しないため、従来のスペーサバターンをそのまま使用し成形すれば、基板上の凹凸部を 考慮してスペーサの位置を正確に制御できるとともに、 スペーサの高さを一定に制御できる。

【0020】スペーサバタン43の材料としては、黒色感光性ポリイミドが使用されている。画素電極以外で生じる光り抜けを防止するブラックマトリックスの効果をも発揮する点で黒色材料を使用することが好ましい。スペーサによる光漏れや光の遮断がなく、このため液晶パネルとしてのコントラストや透過率の向上が図られるからである。このようなスペーサバタン43としては、ボ

リイミドとポリウレタンとを混合した材料を使用しても 良い。ただし、フィーサパタン43としては、液晶30 や配向膜との反応性がないものであり、両基板間のセル 厚dを形成できるものであっても良い。

【〇〇21】スペーサパタン43は、画素電極34に相当する部分以外の全部分に形成する必要はなく、画素電極34に相当する部分以外であれば一部にのみ形成しても良い。ただし、画素電極34に相当する部分以外の一部にのみ形成するよりも、画素電極34以外の全部分に形成することが好ましい。両基板35,36のギャップをより確実に形成することができるためであり、また、スペーサパタン43に黒色樹脂素材を使用することにより、画素電極34以外の部分の光抜けをより広い範囲で防止することができるためである。

【0022】スペーサパタン43が形成された第2の基板35の表面には、配向膜31が形成されている。配向膜31は、その厚さが20nmであり、ウレタン樹脂MS-5510(ガラス転移温度Tg=63°C、三菱重工業製)を10重量%混合したオプトマーAL1254の希釈液(固形分温度2%)を塗布することにより形成されている。配向膜31にはラビングなどの配向処理が施されていない。これは、スペーサパタン43の厚さによるラビングむらの問題を解消するためである。なお、ラビング配向処理を行なうと、静電気が発生し配向膜に絶縁破壊が起きたりするが、本発明によれば、ラビング配向処理が不要なためこのような問題は発生しない。

【0023】配向膜31、32には、ポリウレタンが一 成分として含まれている。これは、流動配向による表示 ムラを解消する目的で、液晶分子を配向方向に再配列さ せるためである。つまり、配向膜31は、ラビングされ ていないため、配向膜31,32の間に液晶を注入する と、配向膜表面では注入時の液晶の流動方向に液晶分子 が配向してしまう。これを流動配向と呼び、表示ムラの 原因となっている。この表示ムラを解決するためには、 流動配向した液晶分子を一軸方向に再配向させる必要が ある。しかし、一旦配向した液晶分子は、液晶と配向膜 の界面において配向膜分子に強く捕捉されている。そこ で、一旦配向膜に強く補足された液晶分子を解放する必 要があるが、これには配向膜分子と液晶分子の両者の熱 運動を活発にすることが効果的である。配向分子の熱運 動が活発になるのはポリウレタンのガラス転移温度以上 であり、液晶分子の熱運動が活発になるのは液晶のネマ チックーアイソトロピック転移温度以上である。したが って、ポリウレタンを一成分として含む配向膜を使用 し、両基板を張り合わせた後に液晶パネルをポリウレタ ンのガラス転移温度以上且つ液晶のネマチックーアイソ トロピック転移温度以上に一定時間加熱すると、液晶と 配向膜の界面における液晶分子及び配向膜分子の分子運 動が盛んになり、吸着されていた液晶分子の動きが活発 となる。その後、温度を下げていくと、ラビングした一

致方向の配向膜面で規制された配向方向に液晶が固定された状態で、液晶分子の再配列が起こり、全面にわたって均一な配向となる。また、この処理によって、液晶分子のプレチルト角が変化し、基板面内での平均的なプレチルト角に揃うようになる。特に、第2の基板36側では、配向膜31がラビング配向処理されておらず、配向膜31の界面において配向方向に乱れが生じやすいことでプレチルト角が変動しやすいため、この処理が有効となる(特開平9-244030号参照)。したがって、本実能の形態の配向膜31、32にはポリウレタンが一成分として含まれている。

【0024】前記両基板35、36は、シール材料51によって張り合わせられており、両基板間35、36には液晶30が封入されている。シール材料51は、5、 1μ mの直径のガラスビーズを1重量部混合した紫外線硬化性樹脂を材料とし、第2の基板35の周辺部に横246mm、縦185mmの長方形状にディスペンサーを用いて塗布されている。また、両基板35、36には、一方方向に振動する光のみを通過させ、表示画面に光を照射する偏光板37、38が設置されている。

【0025】液晶30は、正の屈折率異方性(△n)を もち、△n値は0.98である。また、液晶分子のねじ れ角 θ は90度であり、液晶の螺旋ピッチが20 μ m (p=(360/*B*)×d)になるようにカイラル液晶 を混合した混合液晶組成物30が使用されている。すな わち、液晶30は、螺旋ピッチャが $p=(360/\theta)$ ×dの関係を満たすようにカイラル材が添加されてい る。本実施の形態における混合液晶組成物30はBDH 社のCB-15を液晶にQ.33重量%添加している。 このように処理した液晶分子は、配向膜31の液晶配向 規制力に頼ることなく、自然に適正なねじれを形成す る。具体的には、カイラル液晶を混合していない液晶を 使用する場合は、液晶分子が適正なねじれを形成するた めに、両配向膜を所定の方向にラビングする必要がある が、本発明ではカイラル液晶を混合した混合液晶組成物 を使用しているため、第1の基板36側の配向膜31が ラビング配向処理していなくても適正なねじれを形成す

【0026】ここで、第1の基板36側に、スペーサバタン43を形成するとともにラビング配向処理しない配向膜31を形成する一方、第2の基板35側に、ラビング配向処理した配向膜32が形成されるようにしても良い。この場合は、画素電極34、TFT42を形成した第1の基板36上において、画素電極34以外の部分に形成する。このように形成すると、第2の基板36側にTFT42や電極ライン等が形成されているために、これらを静電気による影響から避けることができるとともに、いわゆる視野角依存性の改善も図られる。

【0027】(第1の実施の形態の液晶表示装置の製造 方法)次に、第1の実施の形態の液晶表示装置の製造方 法について説明する。

[0028] 図2の平面図に示すように、第2の基板36上にTFT42と電極配線及び画素電極34を形成した後、画素電極34の表面に配向膜32を乾燥後の厚さが50nmになるように印刷塗布し、200°Cで1時間加熱乾燥させる。配向膜32の配向材料は、ポリイミド材料で、日本合成ゴム様式会社製オプトマーAL1254である。配向膜32には乾燥後に一般的な回転ラビング方法により配向処理を施せば足りる。

【0029】一方、第2の基板35には、全面にパターン化していない「TOベタ電極33を形成し、その上にスペーサパタン44を黒色感光性ポリイミド43が厚さ5.1μmになるように形成する。スペーサパタン43は、黒色樹脂層をパターン化したもので、図2の画素電極34に相当する部分のみが開口したマスクを用いてまり線を照射した後、現像し、未硬化の感光性ポリイミドを除去することにより画素電極34に相当する部形状に形成する。スペーサパタン43は、前記形状に限らず、両基板35、36のギャップを形成でき、からでき、のでであれば良い。したがって、従来の特開平6-273735号公報のように、ラビングむらを防止するための工程は必要ない。

【0030】次いで、第2の基板35側に、ウレタン樹脂MS-5510(Tg=63°C、三菱重工業製)を10重量%混合したオプトマーAL1254の希釈液(固形分濃度2%)を塗布し、20nm厚の配向膜31を形成するが、この配向膜31にはラビング配向処理を施していない。ラビング配向処理を施さないことにより、従来のラビングむらによる問題は発生せず、なおかつ、ラビング配向処理の工程を削減することができる。次いで、貼り合わせ後にシール幅が0.5mmになるように量を調整したシール材料51を第1の基板36の周辺部に塗布した。

【0031】次に、液晶分子のねじれ角のは90度であり、液晶の螺旋ビッチが20ミクロン(p=(360/6)×d)の関係を満たすようにカイラル液晶を混合し、混合液晶組成物30を製造した(但し、のは液晶分子のネジレ角度を表す)。本実施の形態ではBDH社の子のネジレ角度を表す)。本実施の形態ではBDH社の日本では混合では、30を製造している。なお、液晶分子は正のを設造している。なお、液晶分子は正のを開発して、前記処理を施した心画基板35、36を滅圧し、前記処理を施した両基板35、36を減圧(20パスカル)下で貼り合わせた。本実施例では、アクを電極34に相当する部分以外の全部分にスペーサパタン43を隔絶するように研状に形成されている(図2)、10元がで、例えば両基板を張り合わせた後に液晶に入

口から液晶を注入する方法によると、スペーサパタン43によって液晶注入口と隔絶されている画素部分には液晶30が注入できない。各画素部分にむらなく液混30を封入するには、本実施の形態のように液晶30を第2の基板36上に滴下した後、両基板を張り合わせる必要がある。この方法によれば、スペーサパタン43は各9で素を隔絶するように併状に形成されているが、液晶30を滴下した後に両基板を張り合わせることによって、高型上に液晶30を隙間なく広げることができる。また、真空注入法のように液晶注入口の近傍でのむらの問題もない。次いで、液晶30が基板35、36間に充填された後、周囲を紫外線硬化樹脂で封じた。

【0032】ただし、本発明は前記液晶封入方法に限るのではなく、液晶30を両基板間にむらなく封入できる方法であれば良く、したがって、スペーサパタン43を一部に形成する場合のようにスペーサパタン43により隔絶される部分がない場合には、一般的な液晶注入口を残して基板35,36を貼り合わせた後、液晶30を注入する工程(真空注入法等)を行っても良い。

[0033]前記工程によって製造された液晶パネル全 体を120°Cで12時間、加熱放置した。加熱放置す ることによって、混合液晶組成物30の液晶分子の配向 が良好になるためである。ここで、配向膜がポリウレタ ンを少なくとも一成分として含むポリイミド樹脂とし、 液晶を両基板に保持する工程の後、パネルをポリウレタ ンのガラス転移温度(Tg)以上且つ、液晶のネマチッ クーアイソトロピック転移温度以上に加熱する。これ は、液晶分子を配向方向に再配列させるためである。ラ ビングしていない配向膜の間に液晶を注入すると、配向 膜表面では注入時の液晶の流動方向に液晶分子が配向し てしまう(「流動配向」)。この表示ムラを解決するた めには、流動配向した液晶分子を一軸方向に再配向させ る必要があるが、一旦配向した液晶分子は、液晶と配向 膜の界面において配向膜分子に強く捕捉されている。一 旦配向膜に強く補足された液晶分子を解放するには、配 向膜分子と液晶分子の両者の熱運動を活発にすることが 効果的である。配向分子の熱運動が活発になるのはポリ ウレタンのガラス転移温度以上であり、液晶分子の熱運 動が活発になるのは液晶のネマチックーアイソトロピッ ク転移温度以上である。したがって、ポリウレタンを一 成分として含む配向膜を使用し、両基板を張り合わせた 後に液晶パネルをポリウレタンのガラス転移温度以上且 つ液晶のネマチック-アイソトロピック転移温度以上に 一定時間加熱すると、液晶と配向膜の界面における液晶 分子及び配向膜分子の分子運動が盛んになり、吸着され ていた液晶分子の動きが活発となる。その後、温度を下 げていくと、ラビングした一致方向の配向膜面で規制さ れた配向方向に液晶が固定された状態で、液晶分子の再 配列が起こり、全面にわたって均一な配向となる。ま た、この処理によって、液晶分子のプレテルト角が変化

し、基板面内での平均的なプレチルト角に揃うようになる(特開平9-244030号参照)。

【0034】 したがって、本発明によれば、スペーサパタン43が形成されている基板側の配向膜においてラビンク配向処理の工程を不要とするため、ラビング配向処理の工程を削減しつつ、表示精度を上げることができる。また、従来例の特開平6-273735号公報のように、ラビング配向処理を均一に行うためにスペーサパタン43の台形状の段差部分(側壁)を所定角度に成形する必要もないため、単純な工程でラビングむらの問題を解決することができる。

【0035】 (実施例1) 前記TN液晶表示素子を 使用して以下の実験を行った。図3に示すように、TN 液晶表示素子にドライバーしSI52を取り付け、TF T-TN液晶表示モジュールを完成させた後、前記TF T-TN液晶表示モジュールに60Hzの矩形波の電気 信号を与えて、第2の基板36側から拡散光で照明し、 各画素を表示させて特性を測定した。その結果、基板面 に垂直な方向から測定したコントラスト値は最大10 0:1であった。ここでのコントラスト値とは、同一の 画面での日の領域の輝度と黒の領域の輝度との比率であ り、配向が完全であるほど黒の状態の輝度が低くなる。 すなわち、遮光性が高くなる。そして、中間調表示の電 圧をかけた状態で表示領域を観測したところ全面にわた って均一な表示状態を示しており、スペーサパタン43 の周辺にもラビングむらに起因するような輝度ムラは発 生しなかった。

【0036】(比較例1)比較例1はラビング配向処理 を必要とする従来の液晶表示装置である。図4に模式的 に示すように、配向膜32のラビング方向に対し90度 になるように配向膜31をラビング配向処理されてい る。また、液晶材料は、ラビング配向処理された配向膜 の液晶分子規制力によって配向する液晶組成物30であ る。ただし、一般的に行われているように、液晶分子の ねじれの方向を一定にするために、少量(約P=16d となる量)のカイラル剤を添加している。本比較例では 液晶に対し約0.1重量%添加している。その他の点は 実施例1と同様である。このTFT-TN液晶表示モジ ュールに電気信号を与えて、第2の基板側から拡散光で 照明し、全画素を中間調表示させたところ、部分的に輝 度ムラのある表示となった。表示部のうち暗い領域を顕 微鏡で反射観測したところ、スペーサパタン43が形成 されている側の配向膜31には、スペーサパタン43の 周辺にラビングされていない部分が多く存在していた。 ラビングされていない部分では液晶分子が一軸方向に配 向しておらず、プレチルト角も一定方向に発現していな かった。

【0037】実施例1と比較例1を比較検討する。比較例1では、スペーサパタン43の周辺に発生するラビングむらを原因として輝度むらが発生した。この原因とし

ては、カイラル材を混合していない 遺常の 液晶組成物 3 0 を使用したことにもある。しかし、 実施例 1 では、スペーサバタン 4 3 を形成した 芸板表面の配向膜はラビングが不要であるため、スペーサバタン 4 3 の厚さを原因とする輝度むらは発生せず、 長好な表示精度が得られた。

【0038】(第2の実施の形態の液晶表示装置の構成)本実施の形態は、図4及び図5に示すように、第1の実施の形態と同様の大きさの第1の基板と第2基板63.61を用いるが、第1の基板と第2の基板63.61は材質がポリエーテルスルホンである。第2の基板61の表面には透明列電極62が配されている。透明列電極62は幅0.315mmであり、透明列電極62、62間のピッチは0.33mmである。一方、第1の基板63表面には、透明行電極64が配されている。透明行電極64は幅0.10mm、ピッチ0.11mmである。

【0039】両基板61、63の間には、第1の実施の形態と同一のネマチック液晶材料65が挟持されている。また、第2の基板61上には厚さ60nmのポリイミド型低温加熱性配向膜66が形成されている。配向膜66は、印刷塗布後、140°Cで2時間加熱処理することによって硬化させた後、ローラーに巻き付けたラビング用のレイヨン布によってラビング配向処理されている。配向膜66をラビング配向処理することによって、配向膜66の界面において液晶分子を一軸方向に配向でせることができる。なお、配向膜66にはスペーサパタン80が形成されていないため、スペーサパタン80の厚さによるラビングむらの問題は発生しない。

【0040】一方、図5に示すように、第1の基板63上には、透明列電極62と透明行電極64とが交差する領域を取り囲むように、高さ5.1ミクロン、幅20ミクロンの土手状のスペーサバタン80が形成されている。スペーサバタン80は、材料がアクリル系ネガ型黒色レジストであるが、第1の実施の形態と同様に前記材料に限定されない。また、黒色材料を使用すること、透明列電極62と透明行電極64とが交差する領域以外の全域に形成することが好ましい点、及び第2の基板61上に形成可能である点も、第1の実施の形態と同様である。

[0041]スペーサパタン80が形成された第1の基板63の表面には、配向膜67が形成されている。配向膜67は厚さが20nmであり、ウレタン樹脂MS+5510(ガラス転移温度Tg=63°C、三菱重工業製)を10重量%混合したポリイミド型低温加熱性配向膜の希釈液(固形分濃度2%)を塗布することにより形成されている。また、配向膜67にはラビング配向処理などの配向処理が施されていない。このため本発明によれば、実施例1と同様にスペーサパタン80の厚さによるラビングむらの問題を解消することができる。なお、

本発明は、前記配向膜の材料に限らず、材料を問わず適用可能である点、また、製造工程において、プレチルト角を揃えることを目的として加熱処理する工程を含む場合は、配向膜67,66にはポリウレタンを一成分として含むことが必要である点は、第1の実施の形態と同様である。両基板61,63は張り合わせられ、両基板間には液晶が挟持されている点、及び両基板61,63には偏光板70、72が配されている点は第1の実施の形態と同様である。

【0042】(実施例2)上記TN液晶表示素子を使用して以下の実験を行った。実施例1と同様に、TN液晶表示素子にドライバーLSI52を取り付け、TN液晶表示モジュールを完成した後、前記液晶表示モジュールに60Hzの矩形波の電気信号を与えて、第2の基板61の側から拡散光で照明し、各画素を表示させて特性を測定した。その結果、全面にわたって均一な表示状態を示しており、スペーサバタン80の周辺にもラビングむらに起因するような輝度ムラは発生しなかった。したがって、本発明は、基板61,63が有機高分子材料であっても適用可能であることがわかる。

【0043】(第3の実施の形態)本実施の形態は、単純マトリックス駆動方式のスーパーツイステッドネマチック(STN)液晶パネルに本発明を適用した場合を示す。本実施の形態の構成は、図6及び図7に示すように、相位差板70,71を有する点、液晶混合組成物65以外は第1及び第2の実施の形態と同様である。また、第1及び第2の基板63,61は、ガラス基板であり、それらの厚さ0.5mmのものを使用した。なお、両基板63,61は、透明電極64、62が配されている。

【0045】一方、第2の基板72の表面には、透明列電極62と透明行電極64とが交差する領域を取り囲むように、高さ7ミクロン、幅20ミクロンの土手状のスペーサパタン80が形成されている。スペーサパタン80の材料及び形成方法は、第2の実施の形態と同様である。スペーサパタン80が形成された第1の基板65の

表面には、第2の実施の形態と同様に、ラビンク配向処理が施されていない配向膜67が形成されている。したがって、スペーサバタン80の厚さによるラビングむらの問題を解消することができる。なお、本発明は、製造工程において、プレチルト角を揃えることを目的として加熱処理する工程を含む場合は、配向膜67.66にはポリウレタンを一成分として含むことが必要である点は、第1の実施の形態と同様である。

【0046】液晶65は、正の屈折率異方性(△n)を もち、△n値は0.122である。また、液晶分子のね じれ角∂は240度であり、液晶の螺旋ビッチが10. $5\mu m (p = (360/6) \times d)$ になるようにカイラ ル液晶を混合した混合液晶組成物65である。本実施の 形態における混合液晶組成物 6 5 はBDH社のCB-1 うを液晶に約0.63重量%添加してある。なお、ST N素子の均一性の向上の観点と製造上の容易さから厚い 方が望ましく、5~7μmが一般的なセル厚dとなって いる。前記処理を施した液晶分子は、第1及び第2の実 施の形態と同様に、配向膜の液晶配向規制力に頼ること。 なく、自然に適正なねじれを形成する。両基板61、6 3には、第2の実施の形態と同様の偏光板が張り合わせ られており、さらに、偏光板には単純マトリックス液晶 パネルの光学補償用として位相差板69,71が張り合 わせられている。

【0047】(実施例3)前記STN液晶表示素子4を使用して以下の実験を行った。実施例1と同様に、STN液晶表示素子にドライバーLSI52を取り付け、PM(単純マトリックス)-STN液晶表示モジュールに6のHzの矩形波の電気信号を与えて、第2の基板63の側から拡散光で照明し、各画素を表示させて特性を測定した。その結果、全面にわたって均一な表示状態を示しており、スペーサパタン80の周辺にもラビングむらに起因するような輝度ムラは発生しなかった。したがって、本発明はSTN液晶表示素子にも適用可能であることがわかる。

【0048】以上、各実施の形態では、アクティブマトリックス駆動方式の液晶パネルと単純マトリックス駆動方式STN液晶パネルに適用したもので説明したが、本発明はいわゆるダイオード方式(MIM)の液晶パネル等にも適用可能である。

[0049]

(発明の効果)本発明の液晶表示装置は、スペーサパターンを使用するために、液晶パネルの基板上の凹凸部を考慮してスペーサの位置を正確に制御できるとともに、スペーサの高さを一定に制御できる。また、スペーサパターンが形成される第2の基板表面にはラビング配向処理しない配向膜が形成されるため、第2の基板側ではラビングむらの問題が生じることがない。したがって、従来の一方の透明電極付き基板の両方にラビング配向処理

が施される配问膜が使用されるものとは異なり、スペーサルタンの厚さにより生じるラビング配向処理の不均一の問題(ラビングむら)が発生することがなく、表示精度の高い液晶表示装置を得ることができる。また、従来公報のように、側壁に所定の角度を設けたスペーサバタンを使用する必要がないため、基板を支える部分が狭くなることがなく、基板間のギャップを確実に形成できる。

【0050】他方、本発明の液晶表示装置の製造方法は、スペーサパタンが形成されている基板側の配向膜においてラビング配向処理工程を不要とするため、スペーサパタンの厚さにより生じるラビング配向処理の不均一の問題が発生することがなく、表示精度の高い液晶表示装置を得ることができる。また、従来公報のように、側壁に所定の角度を設けたスペーサパタンを使用する必要がないため、簡単な工程で表示精度の高い液晶表示装置を得ることができる。

[0051]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の概略断面図である。

【図2】上記第1の実施の形態のスペーサパタンの形成 状態を示す平面図である。

【図3】上記第1の実施の形態の液晶表示モジュールの 平面図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態における液晶表示装置の概略斜視図である。

【図5】上記第2の実施の形態における液晶表示装置の 断面図である。

【図6】本発明の第3の実施の形態における液晶表示装置の概略斜視図である。

【図7】上記第3の実施の形態における液晶表示装置の 断面図である。

【符号の説明】

30,65 液晶(混合液晶組成物)

31 配向膜(第2の基板側)

32 配向膜(第1の基板側)

33 共通電極(第2の基板側)

34 画素電極(第1の基板側)

35,61 第2の基板

36,63 第1の基板

37,38 偏光板

42 トランジスタ部(TFT)

43.80 スペーサバタン (黒色樹脂棉層)

51,68 シール材料

52 ドライバーLSI

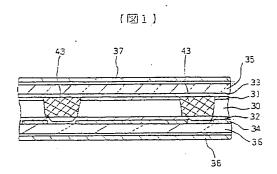
62 列電極

6.4 行電極

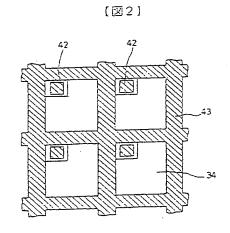
66,67 配向膜

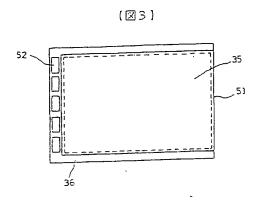
も9、71 位相差板

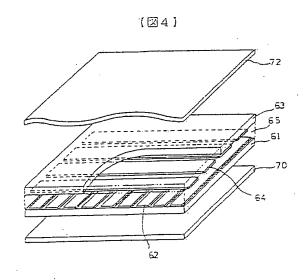
70,72 偏光板



30 板系(混合液晶起版物) 35 第2の基度 31 起向原 36 第1の基度 32 起向原 37,38 信光版 33 大通電低 43 スペーサバタン 34 電素管板、

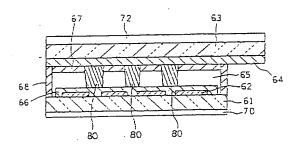






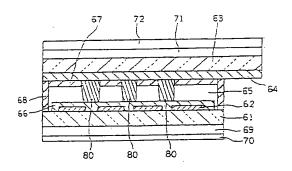
61 実2の基底 54 行電框 62 列信版 65 転品 63 素1の表板 70,72 扇光板





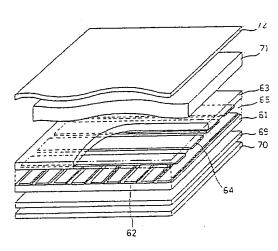
| 61 | 第2の基版 | 65,67 配向政 |
|------------|-------|------------|
| 6 2 | 列章振 | 6.8 シール材料 |
| 5 3 | 第1の基框 | 70.72 個光板 |
| 6 4 | 行动框 | 80 スペーサバタン |
| €€ | 张楠 | |

[図7]



| | 6 l | 第2の募板 | 6 | б. | 5 | 7 | 配約取 |
|---|-----|-------|---|----|---|----|------|
| | 6 2 | 列亞斯 | 6 | 8 | シ | JL | 정되 |
| İ | | | 6 | 9. | 7 | 1 | 位相歪板 |
| ļ | 6 4 | ក្នុង | 7 | 0. | 7 | 2 | 值光星 |
| | 5.5 | ÆÃ | 8 | C. | ス | ベー | サバタン |
| | | | | | | | |

[図6]



| 61 | 第2の量板 | €5 रू ⊈ | |
|-------|-------|----------------|------|
| - 6 2 | 州安陆 | 69.71 | 位相亚级 |
| 6 3 | 第1の基礎 | 7.0. 7.2 | 頃光板 |
| 6 4 | 行组匿 | | |